

スパッタリング装置仕様

CFS-4ES型 (1号機)

| | | | | |
|--------|---------------------|--------------|-------------|-----|
| スパッタ方式 | サイドスパッタ | 基板加熱 | MAX300℃ | |
| 基板ホルダー | Φ200mm | 逆スパッタ | 可能 | |
| 膜厚分布 | ±10%位 (Φ150mm以内) | 反応スパッタ | 可能 | |
| | | スパッタ用電源 | RF MAX 300W | |
| スパッタ源 | マグネトロン式 スパッタ源3個 | 排気系 (ポンプ) | 粗引き | 油回転 |
| | | | メイン | 油拡散 |



SRV-4300型 (2号機)

| | | | | |
|--------|---------------------|--------------|---------------------------|-----|
| スパッタ方式 | スパッタアップ | 基板加熱 | MAX300℃ | |
| 基板ホルダー | Φ320mm | 逆スパッタ | 可能 | |
| 膜厚分布 | ±10%位 (Φ220mm以内) | 反応スパッタ | 可能 | |
| | | スパッタ用電源 | RF MAX 500W DC MAX 1kW | |
| スパッタ源 | マグネトロン式 スパッタ源3個 | 排気系 (ポンプ) | 粗引き | 油回転 |
| | | | メイン | 油拡散 |



SRV-4310型 (3号機)

| | | | | |
|--------|---------------------|--------------|---------------------------|------|
| スパッタ方式 | スパッタアップ | 基板加熱 | MAX300℃ | |
| 基板ホルダー | Φ320mm | 逆スパッタ | 可能 | |
| 膜厚分布 | ±10%位 (Φ220mm以内) | 反応スパッタ | 可能 | |
| | | スパッタ用電源 | RF MAX 500W DC MAX 1kW | |
| スパッタ源 | マグネトロン式 スパッタ源3個 | 排気系 (ポンプ) | 粗引き | 油回転 |
| | | | メイン | クライオ |



CFS-12P-100型 (4号機)

| | | | | |
|--------|------------------------------|--------------|--------------------------|-------------------|
| スパッタ方式 | スパッタアップ | 基板加熱 | MAX180℃ | |
| 基板ホルダー | Φ396X4ステージ Φ1000X1ステージ | 逆スパッタ | 可能 | |
| 膜厚分布 | ±10%位 (Φ1000ステージ は要相談) | 反応スパッタ | 可能 | |
| | | スパッタ用電源 | DC MAX 2kW RF MAX 2kW | |
| スパッタ源 | マグネトロン式 スパッタ源3個 | 排気系 (ポンプ) | 粗引き | 油回転 メカニカルブースター |
| | | | メイン | クライオ |



* 記述、画像、写真の無断転載・転用を禁止します。



SDH10311型 (5号機)

| | | | | |
|--------|--------------------|--------------|------------|---|
| スパッタ方式 | サイドスパッタ | 基板加熱 | 不可 |  |
| 基板ホルダー | Φ410X4ステージ | 逆スパッタ | 可能 | |
| 膜厚分布 | ±10%位 | 反応スパッタ | 可能 | |
| | | スパッタ用電源 | DC MAX 4kW | |
| スパッタ源 | マグネトロン式 スパッタ源3個 | 排気系 (ポンプ) | 粗引き | |
| | | | メイン | クライオ |

SRV-4320型 (6号機)

| | | | | |
|--------|---------------------|--------------|---------------------------|--|
| スパッタ方式 | スパッタアップ | 基板加熱 | MAX300℃ |  |
| 基板ホルダー | Φ320mm | 逆スパッタ | 可能 | |
| 膜厚分布 | ±10%位 (Φ220mm以内) | 反応スパッタ | 可能 | |
| | | スパッタ用電源 | RF MAX 500W DC MAX 1kW | |
| スパッタ源 | マグネトロン式 スパッタ源3個 | 排気系 (ポンプ) | 粗引き | |
| | | | メイン | ターボ分子 |

STV10321型 (7号機)

| | | | | |
|--------|-----------------------------|--------------|--------------------------|--|
| スパッタ方式 | スパッタアップ | 基板加熱 | MAX200℃ |   |
| 基板ホルダー | Φ410X4ステージ Φ500X1ステージ | 逆スパッタ | 可能 | |
| 膜厚分布 | ±10%位 (Φ500ステージ は要相談) | 反応スパッタ | 可能 | |
| | | スパッタ用電源 | DC MAX 4kW RF MAX 2kW | |
| スパッタ源 | マグネトロン式 スパッタ源3個 | 排気系 (ポンプ) | 粗引き | |
| | | | メイン | ターボ分子 |

* 記述、画像、写真の無断転載・転用を禁止します。

